This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 56-161647

(43) Date of publication of application: 12.12.1981

(51)Int.Cl.

H01L 21/58

(21)Application number : 55-063903 (71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing: 16.05.1980 (72)Inventor: SOGA TASAO

OGAWA TAKUZO

TAMAMURA TATEO

CHIBA AKIO

SHIMIZU SEIKI

KUNIYA KEIICHI FUNIYU MASAO

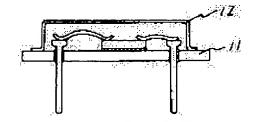
KATO HIROSHI

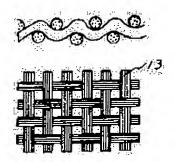
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease the thermal resistance and improve the power cycle-proof of a high power transistor by a method wherein an element is fixed to a stem provided with, for example, copper-carbon fiber which is almost equivalent in the coefficient of thermal expansion and high in thermal conductivity as compared with the element, in the semiconductor device comprising a heat sink and the stem fixed with the heat sink.

CONSTITUTION: For example, a substrate of the composite fiber of 50% copper and 50% carbon in the volume ratio is manufactured by plain weaving a fiber bundle 13 of the copper-plated carbon fiber or $7W8\mu m$ diameter and hot-pressing the fiber bundles superimposed by two sheets. The composite substrate





can be made 2.0W/cm°C in the thermal conductivity and 3.5W4.0×10-6/°C in the coefficient of thermal expansion. The composite substrate is silver-soldered to an iron stem to form the

stem 11 after being Ni-plated. A chip of the power element is fixed by a highly-heated solder and covered with a cap 12 to be made the element. Thereby, the device can be constructed in the low thermal resistance and the power cycle- proof, and in addition, the cost is reduced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 56161647 A

(43) Date of publication of application: 12.12.81

(51) Int. CI

H01L 21/58

(21) Application number: 55063903

(22) Date of filing: 16.05.80

(71) Applicant: HIT

HITACHI LTD

(72) Inventor:

SOGA TASAO OGAWA TAKUZO TAMAMURA TATEO CHIBA AKIO SHIMIZU SEIKI

KUNIYA KEIICHI FUNIYU MASAO KATO HIROSHI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

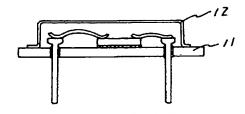
(57) Abstract:

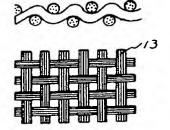
PURPOSE: To decrease the thermal resistance and improve the power cycle-proof of a high power transistor by a method wherein an element is fixed to a stem provided with, for example, copper-carbon fiber which is almost equivalent in the coefficient of thermal expansion and high in thermal conductivity as compared with the element, in the semiconductor device comprising a heat sink and the stem fixed with the heat sink.

CONSTITUTION: For example, a substrate of the composite fiber of 50% copper and 50% carbon in the volume ratio is manufactured by plain weaving a fiber bundle 13 of the copper-plated carbon fiber or 7W8µm diameter and hot-pressing the fiber bundles superimposed by two sheets. The composite substrate can be made 2.0W/cm°C in the thermal conductivity and 3.5W4.0×10⁻⁶/°C in the coefficient of thermal expansion. The composite substrate is silver-soldered to an iron stem to form the stem 11 after being Ni-plated. A chip of the power element is fixed by a highly-heated solder and covered with a cap 12 to be made the element. Thereby, the device can be constructed in the low thermal resistance and the power cycle- proof, and in

addition, the cost is reduced.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio





(9) 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56-161647

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/58

識別記号

庁内整理番号 7638-5F ③公開 昭和56年(1981)12月12日 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分半導体装置

创特

願 昭55--63903

②出 類 昭55(1980)5月16日

⑩発 明 者 曽我太佐男

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

@発 明 者 小川卓三

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

@発 明 者 玉村建雄

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 千葉秋雄

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑰発 明 者 清水誠喜

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 国谷啓一

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑩出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

仍代 理 人 弁理士 高橋明夫

最終頁に続く

明 紐 包

発明の名称 半導体装置

特許請求の範囲

1. 半導体素子を、ヒートンンクとそれを固定するステムからなり前記ステムはその熱伝導塞が前記素子より高く、かつ熱膨張係数が前記素子とほぼ等しい材料によつて構成したことを特徴とする半導体装置。

希明の辞細な説明

本発明はパワートランジスタのステムもしくは ヒートシング材料に関する。

第1図(a)、(b)は従来法を示す。パワートランジスタのSiチンプは、鉄ステム2にかしめられて固定された銅ヒートシンク3上に高温はんだ(PbーSnーA8)により接合されている。Siチンジ上の端子はAL殻5の超音波ワイヤボンデイングにより接合され、他端はNiめつきされたFeーNiポスト6に接合されている。FeーNiポストと鉄ステムがガラス7で固溶され絶録されている。またキャンプ8はNiめつきされた鉄を用

いて、全局をリング9接合されている。Siチッ プが小さい場合は第1図(a)の銅ヒートシンク方式 でも、はんだ付部はパワーサイクルに十分射えら れる。しかレパワー化されるにつれSiチップす 法は大きくなつてきた。このためSiチップと銅 との熱膨張係数の差が大きく、寸法効果が顕著に なるため、パワーサイクルに耐えきれなくなる。 そこで第1図(b)に示したNiめつきしたMo(も しくはW)ヒートシンク10を使う必要がでてく る。Mo(熱膨張係数:4.9×10-0/で)とSi (熱膨張保敵:3.0×10-°/C) との熱膨張係数の 差は小さく、そしてMoとFe(熱膨張係数: 12×10-0/で)との熱膨張係数の差も、銅と Siの差ほどは大きくないので、耐パワーサイク ルに関しては第1図(a)方式より第1図(b)方式がほ れている。ところがMo板は髙価であり資源的な 面でも問題がある。そとでMo以上の熱伝導率を 有し、かつ熱疲労に十分耐えられる材料の開発が 要求された。

本発明の目的は、機能的にMo,Wib優れた

世能をもつ複合材料を開発したことにより、Mo, Wに代る新材料かよびその機能を生かした新たな 構造を提供するととにある。

炭素と銅との配合比により、熱膨張係数と熱伝導率は変る。しかし、熱膨張保数を低下させると 熱伝導率も低下する関係にある。そこで、熱疲労 が問題にならない程度に熱膨張係数を大きくする ことにより(Moより大きくとれる)、熱伝導率 を高く(Moより高くなる)したパワートランジ スタ用ステムおよびその構造。

網一炭素複合材料は熱伝導性に優れると共に炭 素繊維の含有量なよび配列を変えることにより熱 膨張保数を調整することが可能である。よつて、 パワートランジスタ用ヒートシンク及びステムに 適した材料を提供することが可能である。

第1図(b)のMoヒートシンクの代りに銅一炭素 複合材を用いた方式について発明する。高出力バ ワートランジスタを対象として、Siチンプは8 ■ ・ の大型のものを用いた。銅一炭素繊維は体積 比で50%銅50%炭素とすることにより、熱伝

第3図は高耐圧を要求されるパワートランジスタの構造である。Siのみでは耐圧不足のため、AL:O。 基板を敷いて、かつ熱抵抗を下げるために鍋・カーボン複合材を合にした場合のフィン(鯯・カーボン複合材)の熱伝導率に対する熱抵抗 およびパワーの関係を示したものである。 熱抵 抗 およびパワーの測定に必要 な 虚度は T = 125 で、T = 40でとした。この計算は軸対称の差分法を用いた。

本発明はパワートランジスタに適用したが、パワーIC等についても応用できる。

本発明はSiチップ基板を対象としたが、同様 の構造において、Si以外の基板(Ge等)を用

導率20(W/mで)、熱膨強係数(3.5~4.0) ×10° / じたる複合基板で得た。複合基板の製 造方法は、直径 7 ~ 8 μm φのカーポン根維に銅 めつきした穣雄京13(6000本/束)を平職 (第3図(a)) にして2枚重ねにし、ホットブレス (1 0 0 0 C · 2 5 0 Kg/cm²) して作る。平磁 法以外の他の配列(第3図(b)はランダム方式、第 3 図(C)は複維の方向を変えて重ねる方式)にかい ても、平職と同等の性能を有する複合材が得られ ることが判つた。またホットプレス以外の方法、 例えば熱間圧延、連続顕進等の方式でも複合材を 作ることが可能である。との場合炭素に銅めつき を施す必要はない。出来上つた複合材を15㎜□ (厚さは 0.5 mm) に切断し、Niめつき後に鉄ス テム2に鉄ろう付した。さらにこの上にPb-5 S n − 1. 5 A 8 高温はんだ 4 を用いて 8 mm □ の Si1基板を築合した。Si基板の端子とポスト との接合はAL根の超音波ワイヤポンデイングを

第2図はヒートシンクを省略し、銅一炭素複合

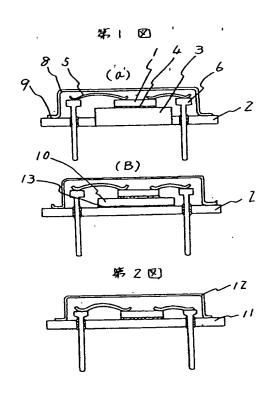
いた場合にかいても、複合基板は応用可能である。 よつて、銅一炭素ヒートンンク、ステムの開発 により、従来以上に低熱抵抗で、耐パワーサイク ル性を有する構造が期待できる。特に高出力パワートランシスタに対して有利となる。またMo方 式と比べるとコストの低波が期待できる。

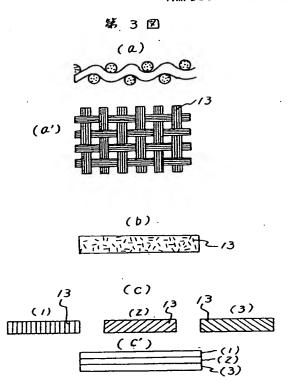
図面の簡単な説明

第1図は従来法による構造の断面図、第2図は 開発した構造の断面図、第3図は銅一炭素繊維の 配列法のモデルを示す図である。

1…Siチンプ、2…鉄ステム、3…銅ヒートンンク、4…高温はんだ付、5…AL線、6…Fe
ーNiポスト、7…ガラス封止、8…キャンプ、
9…リング接合、10…Moヒートシンク、11
…鋼一炭素ステム、12…FeーNiーCoキャンプ、13…銀ろう付。

代理人 弁理士 高僑明夫





第1頁の続き

@発 明 者 舟生征夫

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

@発明者加藤弘

高崎市西横手町111番地株式会 社日立製作所高崎工場内